



Rx_15 (Iridium)

Date	Labo	Intervenant	Technologie	Caractéristiques	Remarques - Masque
	University Wafers			Wafer Si 3" 1micron SiN	
17/09/ 14	CTU	DN	Enrésinement pour electrodes Ir	AZ5124 + primer	Masque " Rx 2x2 PRE- CONTACTS" 115° 1 min - 1.5s - 125° 1 min - 12s dév 28s MIF 726 RAS
29/9/14	CSNSM	LB	Evaporation Ti + Ir	Ti 20A + Ir 200A	20 A Ti + 200 A Ir
06/10/ 14	CTU	DN	Lift-off	Hotte lift-off	1165 chaud à 65° + ultrasons => OK
	CSNSM	LB /LD	Evaporation NbSi		
	CTU	DN	Enrésinement pour TES NbSi	S1805 + primer Masque "Rx 2x2 MEANDRE"	Masque "Rx 2x2 MEANDRE" Recuit 115° 1min30s Insolation: 25mJ/cm2 Dév 30s dans MF319
	CTU	DN	Gravure NbSi	RIE AV	Programme "gravure thermo NbSi"
	CTU	DN	Enrésinement pour chauffage Au	AZ5124 + primer	Masque " Rx 2x2 CHAUFFAGE"

	CTU	DN	Plasma O2	RIE STS 70sccm 120W 12s	
	CTU	DN	Evaporation Au	Ti 20A + Au 500 A	Evap Plassys
	CTU	DN	Lift-off	Acétone	RAS
	CSNSM	SM	Mesures à froid		
	CTU	DN	Enrésinement pour trous traversants	Résine AZ4562	recuit 1h à 90° - insolation 40s dév 4 min 30s dans AZ400K:eau (1:4)
	CTU	DN	Gravure nitrure	RIE STS	recette Nitiram
	CTU	DN	Gravure profonde Si	1h30 recette Qubic_etch	ultrasons ? (pour casser les membranes de SiN qui bouchent les trous en face arrière)
	CTU	DN	Nettoyage résidus	Acétone + 1165 chaud	